

(参考) 特許料等の減免措置一覧(2008年4月現在)

		措 置 内 容		
対 象	出願日	～ H 1 6 . 3 . 3 1	H 1 6 . 4 . 1 ～ H 1 9 . 3 . 3 1	H 1 9 . 4 . 1 ～
国		免除 (特許法第 1 0 7 条、 1 9 5 条)		
国立大学法人、 大学共同利用機関法人、 (独) 国立高等専門学校機構			免除 (産業技術力強化法附則第 3 条)	H19.4.1以降の出願は、下記の アカデミック・ディスカウント を対象とした特許料等の減免措 置が適用されます。
国立大学法人承認 T L O			免除 (T L O 法 ^{*1} 附則第 3 条)	H19.4.1以降の出願は、下記の 大学等承認 T L O を対象とした 特許料等の減免措置が適用され ます。
大学等承認 T L O		審査請求料：半額軽減 特許料 1 ～ 3 年分：半額軽減 (産業再生法 ^{*2} 第 5 6 条、 5 7 条)		
試験研究型独立行政法人 認定 T L O		免除 (改正法 ^{*3} 附則第 8 条)	審査請求料：半額軽減 特許料 1 ～ 3 年分：半額軽減 (T L O 法第 1 3 条)	
国立試験研究機関 認定 T L O		免除 (T L O 法第 1 3 条)	免除 (T L O 法第 1 2 条)	
独立行政法人 (H16.3.31時点で特許法施行 令に指定されているもの)		免除 (改正法附則第 2 条 4 項)		
独立行政法人 (産業技術力強化法施行令 に指定されているもの) ^{*4}			審査請求料：半額軽減 特許料 1 ～ 3 年分：半額軽減 (産業技術力強化法第 1 7 条)	
資力に乏しい個人		< 特許 > 審査請求料：免除、半額軽減 特許料 1 ～ 3 年分：免除、 3 年間猶予 (特許法第 1 0 9 条、 1 9 5 条の 2) < 実用新案 > 実用新案技術評価請求料：免除、半額軽減 実用新案登録料 1 ～ 3 年分：免除、 3 年間猶予 (実用新案法第 3 2 条の 2、 5 4 条)		
資力に乏しい法人		審査請求料：半額軽減 特許料 1 ～ 3 年分： 3 年間猶予 (特許法第 1 0 9 条、 1 9 5 条の 2)		
アカデミック・ディスカウント (大学等、大学等の研究者)		審査請求料：半額軽減 特許料 1 ～ 3 年分：半額軽減 (産業技術力強化法第 1 7 条)		
研究開発型中小企業		審査請求料：半額軽減 特許料 1 ～ 3 年分 ：半額軽減 (産業技術力強化法第 1 8 条、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第 9 条 ^{*5}) 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく措置内容のうち、 特許料は第 1 ～ 6 年分が半額軽減となります。		
公設試験研究機関等 ^{*4}			審査請求料：半額軽減 特許料 1 ～ 3 年分：半額軽減 (産業技術力強化法第 1 7 条)	

注1：上記の減免措置は、特許について対象としており、実用新案(資力に乏しい個人を除く)、意匠、商標については対象外となります。

注2：平成20年4月1日以降に手続する減免対象手続(審査請求及び特許料第1～3年分等)より、特許を受ける権利が共有の場合において、その共有者のうちの者が特許を受ける権利を放棄したことにより、その放棄した持分(特許を受ける権利)が他の共有者に帰属する場合の当該共有者への減免措置が適用対象となります。

*1 T L O 法：大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

*2 産業再生法：産業活力再生特別措置法

*3 改正法：特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)

*4 産業技術力強化法第17条に基づく「独立行政法人」及び「公設試験研究機関等」に対する減免措置の適用は、平成16年4月1日以降の審査請求及び特許料納付手続から対象

*5 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第9条に基づく「研究開発型中小企業」に対する軽減措置の適用は、平成18年6月13日以降の審査請求及び特許料納付手続から対象